



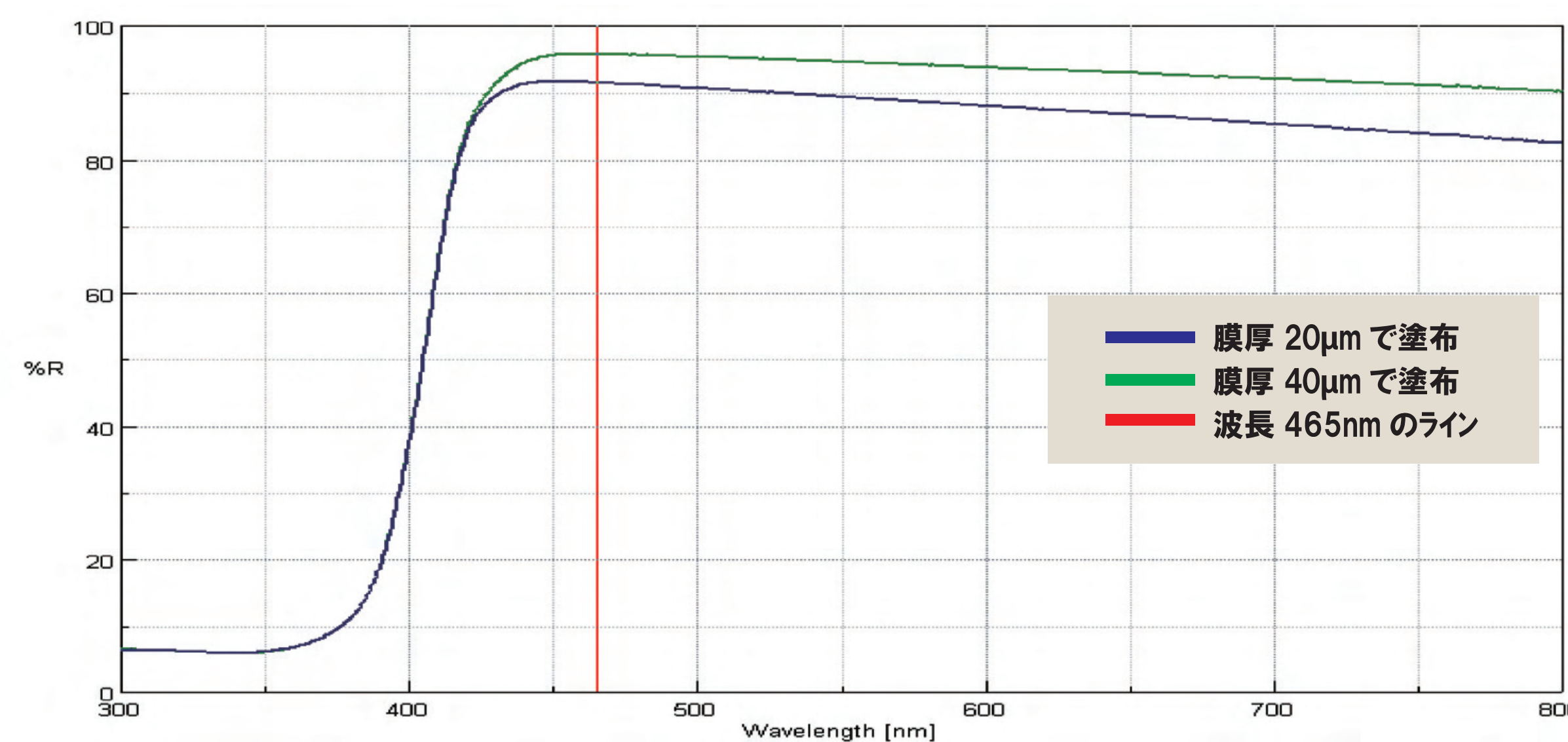
高反射レジスト

High reflectance Resist

アルカリ現像型白色レジスト

Alkaline developable white resist

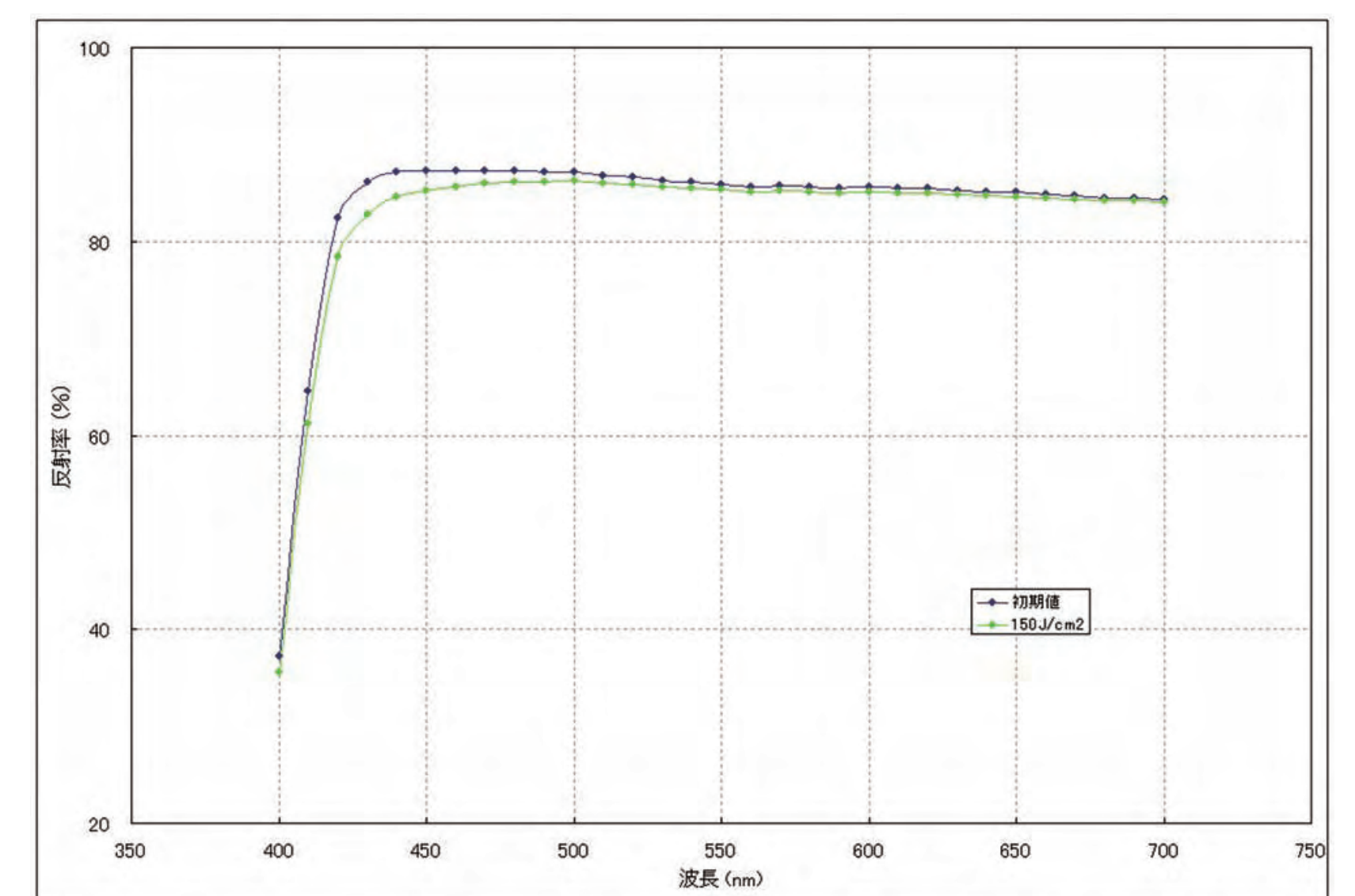
- **反射性に優れる 反射率 90% (465nm 膜厚 20 μ m)**
Excellent reflectance 90% @465nm, (thickness 20 μ m)
- **フォトリソ工法により微細形状の加工が容易**
Easy high-resolution production by Photolithography process
- **可とう性のある基材に追従** Applicable to flex material
- **低温プロセスで、樹脂基材に対応**
Applicable to resin base material under low temp process
- **耐熱のあるタイプも用意 (オーバーコート用)**
High heat resistance version available (for overcoating)
- **白色基材の上に形成することにより、より高い反射率を有する (95% 以上 465nm)**
Even higher light reflection if coated on white base material (Above 95% @465nm)



紫外線硬化型白色材料

UV-curable white material

- **高反射率** High reflectance
- **紫外線硬化 (低温硬化可能)**
UV-curable (Low temperature curable type)
- **高変色耐性** Superior discoloration resistance



試験項目 Test Items	試験条件 Test Condition	L*a*b*	反射率 Reflectance
初期値 Initial		94.-0.9.0.2	87%
耐光性 Light resistance	積算光量 150J/cm ²	94.-1.3.1.3	85%
耐熱性 Heat resistance	150°C 50hrs.	94.-1.9.3.4	82%

